

ура для прецизионных измерений параметров электронных спектров их/А.Г. Бударин, В. А. Вентцель, О. А. Воронов, А. В. Руднев //

ахг А. 1. Бударин, В. А. Вентцель, О. А. Воронов, А. В. Руднев // ельная техника. – 1982. – № 4. – С. 66–68. шие измерения эффективных масс в кадмин методом эффекта де Га-ил Альфена / А. Г. Бударин, В. А. Вентцель, О. А. Воронов и др.// -1983. – 84, вып. 4. – С. 1511–1516. весокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления до 18 кбар для работы при гелиевых температурах / исокого давления с посотиский. В. А. Сухонаров // ПТЭ. – № 6. – С. 161–164.

авления на поверхность Ферми кадмия / В. А. Вентцель, О. А. Воро-II. Лихтер, А. В. Руднев // ЖЭТФ. -. 1976. - 70, вып. 1. - С. 1706-

инь Ферми кадмия при электронно-топологическом фазовом переходе венем / С. Л. Будько, А. Н. Вороновский, А. Г. Гапотченко, Е. С. Ицке-ЖЭФ.— 1984.— 86, вып. 2.— С. 778—783. вкл В. П., Марьяхин А. А., Мельник В. Л. Изучение поверхности памия // ЖЭТФ.— 1967.— 52, вып. 3.— С. 617—628. • W. A. Electron structure of polyvalent metals // Phys. Rev.— 1960.—

5.- P. 1190-1206.

unds D. M. Asbel' — Kaner cyclotron resonance in zinc // J. Phys. F.--3, N 5.- P. 988-1002.

Cyclotron resonance on improved specimens of zinc // Phys. Rev. B .--I. N 4.- P. 1479-1486.

высоких давлений

Получено 30.07.85

Московской обл.

## едемьянов, в. р. соболь, л. л. дрозд, в. н. матвеев локационное рассеяние и перенос заряда в меди

ин гальваномагнитные измерсния на пластически деформированных имческих медных образцах. Обнаружено эффективное малоугловое растонов проводимости. Точечные и размерные дефекты, генерируемые пленях инзкотемпературной пластической деформации, изменяют харакзавленмости магингосопротивления как для открытых, так и для замкнуших траскторий. При сравнительно больших илотностях деформационрассеяние электронов становится преимущественно изотронным.

овлиянии протяженных дефектов кристаллической структуры жкие коэффициенты меди изучается в настоящее время весьма .Приято считать, что основной вклад в добавочное дислокаизтросопротивление при T = 4,2 К вносит высокоугловое распрах протяженных дефектов [<sup>1</sup>]. Однако, как ноказано в [<sup>2,3</sup>], ная зависимость теплопроводности при малых деформациях Т ≤ 4,2 К не линейна, причем теплопроводность изменяется и деформации не монотонно. Кроме того, оценка плотности по приросту теплосопротивления дает значение на несколько ние по сравнению с другими более прямыми методами. Данные в связываются с рассеянием электронов на квазилокальных ных модах, упругих полях напряжений и с так называемым жтом. В работе [4], в которой изучалась температуриая завивочного дислокационного электросопротивления, показано, исимость в области температур T = 30 - 90 К имеет вид стуизличных способах и степенях деформации.

естно, в сильном магшитном поле при наличии определенных и у поверхности Ферми (ПФ), приводящих к быстрому измекана распределения электронов в импульсном пространстве, вы малоугловых столкновений может существению возрастать ис этим зависимость магиптосопротивления от температуры

и других характеризующих расссеяние параметров, а также от орнентации и величины магнитного поля, когда осуществляется выход на асимптотическую зависимость, определяется особенностями механизмов рассеяния [<sup>4</sup>]. В работе [<sup>7</sup>] исследовано влияние продольного магнитного поля на зависящую от температуры часть сопротивления медных вискеров. Установлено, что воздействие деформации, как и магнитного поля, увеличивает область квадратичной температурной зависимости сопротивления от 1,5 до 2,3 К. Данные явления связываются с резкой анизотронней времени релаксации электронов на ПФ, т. е. воздействие дислокаций и магнитного поля имеют одну природу [<sup>8</sup>].

В настоящем сообщении представлены результаты исследования влияния инзкотемпературной пластической деформации монокристаллов меди на их электроперенос в поперечном магнитном поле. Используемые в эксперименте семейства образцов Сu-1 и Cu-2 подвергали многократной сту-





Рис. 1. Зависимость поперечного магнитосопротивления  $\Delta \rho_H / \rho$  семейства образцов Сп-1 от степени деформации (a)  $(I - H = 20, 2 - 40, 3 - 55 \kappa_3)$  и от магнитного поля (б)  $(I - \varepsilon = 0, 2 - 0.2, 3 - 0.8, 4 - 5.8, 6 - 7.4 \%); О, <math>\bullet$  – данные для образцов до и после отжига.

пенчатой деформации при температуре жидкого гелия. После каждого нагружения образцы выдерживали при T = 100 °C в течение одного часа с последующим медленным охлаждением [4]. Ось образцов Cu-1 совпадала с осью симметрии третьего порядка, а для семейства Cu-2 — с осью четвертого порядка. Ориентация вектора напряженности магнитного поля *H* для Cu-1 приводила к существованию только замкнутых орбит, а для Cu-2 имелся слой открытых траекторий. Сопротивление регистрировали при T = 4,2 К в магнитном поле гелиевого криостата УИС-1 иемедлению после холодной деформации и после отжига вакансий.

На рис. 1 представлены деформационная и полевая зависимости магнитосопротивления  $\Delta \rho_{\mu}/\rho$  образцов Cu-1, где  $\Delta \rho_{\mu}/\rho = (\rho_{\mu} - \rho)/\rho$ ,  $\rho_H$ и ρ — сопротивление в магнитном поле Н и в его отсутствие. Как видно из рис. 1, а, даже для неотожженного состояния магнитосопротивление немонотонно зависит от деформации, при деформации ~0,8 % имеется экстремум, величина которого резко возрастает с отжигом вакансий. Полевая зависимость  $\Delta 
ho_{\mu} / 
ho$  характериа тем, что если для исходного состояния ее вид близок к насыщению, то при малых деформациях (е ~ 0,8 %) зависимость магнитосопротивления от магнитного поля более сильная как в отожженном состоянии, так и без отжига. При сравнительно больших деформациях (е ~ 7 %), магнитосопротивление возрастает с увеличением поля гораздо слабее, а величина магнитосопротивления до и после отжига различается незначительно. Как показано в [8], эффективные времена релаксации, определяющие электропроводность в области сильных магнитных полей т<sup>∞</sup> и в нулевом магнитном поле т<sup>0</sup>, могут существенно отличаться друг от друга н в связн с этим области сильных и слабых магнитных полей

## Дислокационное рассеяние в меди

ны областью промежуточных магнитных полей (ОПМП). Это связчастности, с тем, что в отсутствие поля проводимость в значительжил определяется временем диффузии через ПФ, а в сильных полях асленных условиях существенным оказывается время переброса о ОПМП имеет место при  $T > T_n$ , где  $T_n$  — некоторая характерная тура, определяемая из соотношения  $T_n/T_0 < 10^{-1}$ ;  $T_0 = \Delta pS$ ишимальное расстояние между поверхностями Ферми в схеме растах зон, S — скорость звука). Для данной орнентации, когда имеют слив замкнутые орбиты,  $T_0$  соответствует 60 К. Таким образом, темта T = 4,2К внолне соответствует ОПМП, в которой процессы переилут приводить к эффективным открытым траекториям, а проводииюст зависеть от магнитного поля не только как  $H^{-2}$ , но и как  $H^{-1}$ . При этом соответствующая компонента тензора сопротивления



Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления семейства образцов Си-2: свличного поля при различной плотности деформационных дефектов: × — ε=0, -0.2. △, ▲ — 0.8. □. ■ — 2 %; б — от степени деформации при различных ща H, кз: 20 (1); 40 (2); 55 (3) (светлые и темные значки — данные для образцов до и после огжига соответственно).

и увеличиваться с увеличением магнитного поля. Наблюдаемые эксизпально зависимости  $\rho_H \sim H^n$  с n < 1, по-видимому, обусловлены по в интеграле столкновений имеется также вклад, обусловленный изми структуры, рассенвающими изотропно, которые, в частности, пот возможность экспериментально наблюдать найерлсовское заие сопротивления.

влевая и деформационная зависимости магнитосопротивления образиг представлены на рис. 2. Характерно, что для исходного состояи = 0) показатель степени в полевой зависимости  $\Delta \rho_H / \rho$  остается поным во всей области магнитных полей, а для слабодеформированностоящия в сильных полях он уменьшается. С отжигом вакансий эта вность усиливается. При более высоких степенях деформации ( $\varepsilon =$ и показатель степени онять возрастает до уровня исходного для иманазона значений H.

формационная зависимость магнитосопротивления  $\Delta \rho_{H}/\rho$  обнаруег уменьшение  $\Delta \rho_{H}/\rho$  с повышением концентрации дефектов структрис. 2, 6). При больших деформациях магнитосопротивление в отожсостоянии выше, чем до отжига, что коррелирует с правилом Колтак как сопротивление в отожжениом состоянии меньше, а при малых вышях имеет место обратное соотношение. Характерная зависимость сопротивления от деформации представлена на рис. 3. Нелинейный характер зависимости ρ (ε) свидетельствует о нелинейном приросте деформационных дефектов.

В работе [<sup>9</sup>] показано, что в присутствии открытости ОПМП возникает с приближением вектора магнитного поля *H* к границе двумерно открытой области на стереографической проекции при условии

$$\mathbf{v}_{F}\beta^{2} < \boldsymbol{\omega}_{c}^{-1} < \boldsymbol{\tau}_{F}, \tag{1}$$

и имеет место в угловом интервале  $|\varphi| < (\omega_c \tau_F)^{-0.5}$ ,  $\beta = T/\Theta$  ( $\Theta$  — температура Дебая,  $\omega_c$  — циклотронная частота,  $\varphi$  — угол, отсчитываемый от границы двумерно открытой области). Для меди с остаточным сопротивлением  $\sim 2 \cdot 10^{-10}$  ом · см и величиной  $\beta \simeq 0,01$  при T = 4,2 К, в магнитном иоле  $H \simeq 50$  кэ соотношение (1) действительно имеет место, при этом  $\varphi \simeq 5^{\circ}$  и почти перекрывает двумерную область открытостей. Следуя [<sup>9</sup>], можно считать, что проводимость как функция магнитного поля пропор-

> циональна  $(\omega_c^2 \mathbf{r}_F)^{-0.5}$ , соответственно этому сопротивление должно возрастать с увеличением магнитного поля с показателем степени, равным 1,5.

> Таким образом, результаты эксперимента показывают, что малые деформации весьма слабо влияют на сечение рассеящия электронов проводимости при электропереносе в нулевом магнитном поле, что согласуется с положением о том, что основной вклад в электросопротивление дает рассеяние электронов на большие углы. Магнитосопротивление же очень чувствительно к малым плотностям деформационных дефектов, при этом аномалии в поведении магнитосопротивления имеют место и в присутствии вакансий. Данное обстоятель-

ство свидетельствует о частично малоугловом характере рассеяния электронов на точечных дефектах. После отжига вакансий изменения в поведении магнитосопротивления особенно велики, т. е. малоугловой характер рассеяния на квазилокальных фононных модах, на полях напряжений, несущественный в иулевом магнитном поле, более ярко выражен в силу эффективной экранировки ядер протяженных дефектов.

При больших деформациях, когда плотность введенных дефектов велика, электронное рассеяние преимущественно изотропно, при этом роль полей напряжений уменьшается как вследствие уменьшения расстояния между, дислокациями, так и в связи с тем, что дислокационная структура имеет более резко выраженный петлевой характер — дислокации замыкаются внутри образца, не выходя на поверхность. При этом поля упругих папряжений уменьшаются с расстоянием по кубическому закону [<sup>10</sup>], и главную роль играют близкодействующие потенциалы ядер протяженных дефектов. При малых деформациях повышение анизотропии вызвано как захватом в ходе низкотемпературной деформации дислокациями примесных атомов, рассеивающих в первом приближении изотропно [<sup>11</sup>], так и вкладом в интеграл столкновений малоуглового рассеяния на вводимых протяженных дефектах [<sup>12</sup>], упругие поля напряжений которых более дальнодействующие, чем в замкнутых дислокационных петлях.

Авторы выражают благодарность А. И. Конелновичу за обсуждение результатов работы, и полезные замечания.



P, 10-10 OM.CM

Б

E DEM'YANOV, V. R. SOBOL', A. A. DROZD, and V. N. MATVEEV ATION SCATTERING AND CHARGE TRANSPORT IN COPPER

dranomagnetic measurements are made on plastically deformed single crystall amples and the effective small-angle scattering of conduction electrons is obserdand size defects generated at small degrees of low-temperature plastic defordange the magnetoresistance field dependence both for the open and closed paths. At comparatively high densities of deformation defects the electron & becomes mainly isotropic.

TOF SYMBOLS.  $\Theta$ , Debye temperature;  $\rho$ , electric resistance;  $\rho_{\rm H}$ , electric win the magnetic field;  $\Delta \rho_{\rm H}/\rho$  magnetoresistance;  $\omega_c$ , Larmore frequency; e, dedegree;  $\tau_{ab}^0$ , effective relaxation time in zero magnetic field;  $\tau_F$ , diffusion relaine;  $\tau_{u}$ , effective Umklapp process relaxation time;  $\tau_{adb}^{ee}$ , effective relaxation time

magnelic field.

SURE CAPTIONS. Fig. 1. Dependence of transverse magnetoresistance to specimens Cu-1 on deformation (a) (1 - H = 20 kOe, 2 - 40 kOe; 3 - 40 kOe;and magnetic field (6) (1 - e = 0; 2 - 0.2%; 3 - 0.8%; 4 - 5.8%; 5 - 0.2%0 and • — before and after annealing, respectively. 2. Dependence of magnetoresistance for specimens Cu-2 on: the magnetic

The periodence of magnetoresistance for speciment Cu-2 off the magnetic neitous densities of deformation defects (a) at different values of e, %: 0 ( $\bigcirc$ ); 0): 0.8 ( $\triangle$ ,  $\triangle$ ); 2 ( $\bigcirc$ ,  $\boxdot$ );  $\bigcirc$ ,  $\triangle$ ,  $\Box$  and  $\bigcirc$ ,  $\triangle$ ,  $\Box$  — before and after anneal-relively; the degree of deformation at various *H*, kOe: 20 (1); 40 (2); 55 (3). (3) Typical dependence of resistivity  $\rho$  on the degree of deformation e after n( $\bigcirc$ ) and after annealing at 100 °C ( $\bigcirc$ ). The inset shows the small deformation

n R. A. The interaction of conduction electrons with dislocations and grain laries // Can. J. Phys. — 1982. — 19, N 5. — Р. 766—778. В А. О., Межов-Деглин Л. П., Касумов А. Ю. Непригодность закона Ви-

и-франца для описания соотношений между тепло- и электропроводностью вчески деформированных кристаллов // ФТТ.- 1981.- 23, вып. 1.- С.

и А. О., Межов-Деглин Л. П. Влияние пластической деформации на тепводность образцов из чистых меди и серебра // ФТТ.- 1982.- 24, вып. -0. 207-210.

акер В. Ф., Кулеско Г. И. Температурная зависимость сечения рассеяния тонов дислокациями в металлах // ЖЭТФ. - 1974. - 67, вып. 6 (12). -1335-2340.

и A. B. The influence of small angle scattering on metallic conduction // Roy. Soc. A. — 1968. — 305, N 2. — Р. 291—318. п.Р. II., Колелиовия А. II. О гальваномагинтных свойствах металлов с за-

ин поверхностями Ферми при низких температурах // ЖЭТФ.— 1974. ыл. 6 (12).- С. 2307-2321.

s G., Kotzler J. Magnetic field enhanced electron-electron scattering in the nity of copper // Phys. Rev. B.- 1985.- 31, N 4.- P. 2535-2538.

M. Wiser N. Effect of dislocation on electron-electron scattering of copper// му. F. — 1983. — 13, N 5. — Р. 1207 — 1211. и Р. И., Колелиович А. И. Гальваномагнитные свойства чистых металлов

или промежуточных магнитных полей // 19-е Всесоюз. совещ. по физике температур: Тез. докл., Минск, 1976. С. 148-149.

🔤 А. М. Основы механики кристаллической решетки.— М.: Наука, 1972.—

на А. Ю., Матвеев В. Н. Возврат электросопротивления в слабодеформииых монокристаллах меди // ФТТ.- 1976.- 18, вып. 12.- С. 3724-3726. исти дислокационного электросопротивления меди, деформированной из-/А.Ю. Касумов, Ч. В. Копецкий, Л. С. Коханчик, В. Н. Матвеев // ФТТ.--23, вып. 1.- С. 271-275.

ки твердого тела BOGHHKOB ALL BCCP, Получено 12.08.85

## В. КАРДЕНАС, М. А. ЛУРЬЕ, В. Г. ПЕСЧАНСКИЙ

## РЕЗОНАНСНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ВСПЛЕСКОВ **МЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ТОНКИХ ПРОВОДНИКАХ**

ажазаны три новых высокочастотных резонансных эффекта в прозрачности атовких пластин, наблюдение которых позволит получить детальную инфор. ниектре и релаксационных свойствах электронов проводимости в металле.